

MEMS研究開発拠点 装置一覧

2025年9月1日現在

No.	装置番号	施設等名称	備考		
			試料寸法	設置場所	用途
1	MEMS001	ウェハディップ洗浄装置	200mm/300mm	TKB812-F	処理
2	MEMS002	ウェハスピン洗浄装置	200mm/300mm	TKB812-F	処理
3	MEMS003	有機ドラフト	300mm 以下	TKB812-F	処理
4	MEMS004	異方性ウェットエッチング装置	200mm	TKB812-F	加工
5	MEMS005	IPA ベーパー乾燥機	200mm	TKB812-F	処理
6	MEMS006	i-線ステッパ	200mm	TKB812-F	加工
7	MEMS007	マスク露光装置	200mm	TKB812-F	加工
8	MEMS008	マスクレス露光装置	500mm 角以下	TKB812-F	加工
9	MEMS010	光学顕微鏡	300mm 以下	TKB812-F	分析・評価
10	MEMS011	Si 酸化膜プラズマCVD 装置	200mm/300mm	TKB812-F	加工
11	MEMS012	スパッタ	200mm	TKB812-B	加工
12	MEMS013	酸化炉	200mm	TKB812-F	加工
13	MEMS015	Si 窒化膜減圧CVD 装置	200mm	TKB812-F	加工
14	MEMS016	ポリ Si 減圧 CVD 装置	200mm	TKB812-F	加工
15	MEMS017	金属膜ドライエッチング装置	200mm	TKB812-F	加工
16	MEMS018	Si 酸化膜ドライエッチング装置	200mm	TKB812-F	加工
17	MEMS019	8"Si 深掘ドライエッチング装置	200mm	TKB812-F	加工
18	MEMS020	12"Si 深掘ドライエッチング装置	300mm	TKB812-F	加工
19	MEMS021	犠牲層ドライエッチング装置	100/150/200mm	TKB812-F	加工
20	MEMS022	アッシャー	300mm 以下	TKB812-F	加工
21	MEMS023	光学検査顕微鏡	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
22	MEMS024	段差測定器	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
23	MEMS025	エリブソメーター	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
24	MEMS026	膜厚測定器	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
25	MEMS027	ウェハ塵埃検査装置	200mm	TKB812-F	分析・評価
26	MEMS028	干渉型表面形状評価装置	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
27	MEMS029	シート抵抗プローバー	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
28	MEMS030	赤外線レーザ顕微鏡	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
29	MEMS031	レーザ顕微鏡	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
30	MEMS032	ブレードダイサー	300mm 以下	2A-CR	加工
31	MEMS033	レーザステルスダイサー	200mm 以下	2A-CR	加工
32	MEMS034	光学顕微鏡	300mm 以下	2A-CR	分析・評価
33	MEMS036	電子ビーム/抵抗蒸着装置	200mm	TKB812-B	加工
34	MEMS037	熱処理装置	200mm	TKB812-B	加工
35	MEMS038	チップ to ウェハ接合装置	100/150/200/300mm	TKB812-B	加工
36	MEMS039	ウェハ to ウェハ接合装置	100/150/200mm	TKB812-B	加工
37	MEMS041	光表面処理装置	200mm	TKB812-B	処理
38	MEMS042	12"ウェハ常温接合装置	100/150/200/300mm	3F-CR	加工
39	MEMS043	測長 SEM	200mm	TKB812-B	分析・評価

40	MEMS044	分析 SEM	300mm 以下	TKB812-B	分析・評価
41	MEMS045	超音波顕微鏡	300mm 以下	TKB812-B	分析・評価
42	MEMS046	赤外線顕微鏡	200mm 以下	TKB812-B	分析・評価
43	MEMS047	薄膜応力評価装置	100/125/150/200 mm	TKB812-B	分析・評価
44	MEMS048	X 線 CT 評価装置	300mm 以下	TKB812-B	分析・評価
45	MEMS049	テスタープローバー	200mm 以下	TKB812-B	分析・評価
46	MEMS050	光学顕微鏡	300mm 以下	TKB812-B	分析・評価
47	MEMS051	圧電薄膜評価装置	100-200mm	3H-CR	分析・評価
48	MEMS053	ダイシエアテスト	100mm 以下	TKB812-B	分析・評価
49	MEMS058	無機ドラフト	300mm 以下	TKB812-F	処理
50	MEMS059	レジスト塗布現像装置	200mm	TKB812-F	分析・評価
51	MEMS060	イオンミリング装置	200mm 以下	TKB812-B	加工
52	MEMS069	自動光学顕微鏡	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
53	MEMS070	レーザードップラー測定器	200mm 以下	TKB812-B	分析・評価
54	MEMS071	フーリエ変換赤外分光装置	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
55	MEMS072	小口径スパッタ	100mm 以下	TKB812-B	分析・評価
56	MEMS073	マニュアルプローバ	200mm 以下	TKB812-B	分析・評価
57	MEMS074	ダイシングフィルム貼付装置	200mm 以下	2A-CR	加工
58	MEMS075	保護フィルム貼付装置	200mm 以下	TKB812-F	加工
59	MEMS076	フォトリソ工程用オープン	200mm 以下	TKB812-F	加工
60	MEMS077	2流体洗浄装置	200mm 以下	3F-CR	処理
61	MEMS078	リフトオフ装置	200mm 以下	TKB812-F	加工
62	MEMS079	レーザーマーカー	200mm 以下	TKB812-F	処理
63	MEMS080	チップソーター	200mm 以下	TKB812-B	加工
64	MEMS081	高速シリコン深掘り装置	200mm 以下	2E-CR	加工
65	MEMS082	高速酸化膜ICPエッチング装置	200mm 以下	2E-CR	加工
66	MEMS083	金属膜ICPエッチング装置	200mm 以下	2E-CR	加工
67	MEMS084	汎用RIE装置	200mm 以下	2E-CR	加工
68	MEMS085	低温対応酸化膜・窒化膜CVD装置	200mm 以下	2E-CR	加工
69	MEMS086	高荷重フリップチップボンダー	100mm角以下	2E-CR	加工
70	MEMS087	ピコ秒レーザー加工機	200mm角以下	2E-CR	加工
71	MEMS088	イナートオープン	200mm角以下	2E-CR	処理
72	MEMS089	酸素プラズマバレル型アッシャー	150mm 以下	2E-CR	加工
73	MEMS090	水蒸気プラズマ対応アッシャー	200mm角以下	2E-CR	加工
74	MEMS091	両面スクラブ・二流体・メガソニックウエハ洗浄装置	200mm 以下	2E-CR	処理
75	MEMS092	高解像度4Kデジタルマイクロスコープ	300mm 以下	2E-CR	分析・評価
76	MEMS093	裏面对応高速レーザー直描装置	200mm角以下	2E-CR	加工
77	MEMS094	裏面对応コンタクトアライナ	100mm 以下	2E-CR	加工
78	MEMS095	青色レーザー顕微鏡	300mm 以下	2E-CR	分析・評価
79	MEMS096	セミアートコーター・デベロッパ	200mm 以下	2E-CR	加工
80	MEMS097	HMDS処理装置	200mm 以下	2E-CR	処理
81	MEMS098	スプレーコーター	200mm角以下	2E-CR	加工

82	MEMS099	光学干渉式膜厚計	300mm 以下	2E-CR	分析・評価
83	MEMS100	触針式段差計	100mm 以下	2E-CR	分析・評価
84	MEMS101	電界放出形電子顕微鏡	100mm 以下	2E-CR	分析・評価
85	MEMS102	冷却イオンミリング装置	小片	2E-CR	加工
86	MEMS103	オスミウムコーター	100mm 以下	2E-CR	加工
87	MEMS104	マニュアルへき開装置	200mm 以下	2E-CR	加工
88	MEMS105	赤外線顕微鏡	100mm 以下	2E-CR	分析・評価
89	MEMS106	マニュアルボールボンダー	小片	2E-CR	加工
90	MEMS107	マニュアルウェッジワイヤーボンダー	小片	2E-CR	加工
91	MEMS108	マニュアルダイボンダー	小片	2E-CR	加工
92	MEMS109	25MHz3次元レーザードップラー振動計	200mm角以下	2E-CR	分析・評価
93	MEMS110	白色干渉式形状観察装置	200mm角以下	2E-CR	分析・評価
94	MEMS111	半導体パラメータアナライザ	—	2E-CR	分析・評価
95	MEMS112	パリレンコーター	200 mm角以下	2E-CR	加工
96	MEMS113	膜応力測定装置	200 mm以下	2E-CR	分析・評価